

JETRO

特許庁委託事業

模倣対策マニュアル

韓国編

2012年3月



第1章 保護対象の種類と根拠法

1. 発明

特許法第1条は“この法は、発明を保護・奨励し、その利用を図ることにより、技術の発展を促進し、もって産業発展に寄与することを目的とする”と規定しており、同法第2条の1では“発明とは自然法則を利用した技術的思想であって高度なものをいう”としてその保護対象を明示している。

韓国特許法は登録主義及び審査主義をとっており、発明は登録を通じて独占排他権として保護を受けることができ、産業上の利用可能性、新規性及び進歩性などの基本的登録要件が不可欠である。

特許権者には独占排他的に特許権を実施する権利が発生し、第三者の無断実施には民・刑事的手段を講ずることができるが、権利乱用による公衆の被害を最小化するために特許無効審判制度などを定め特許権者と第三者との利益の均衡を図っている。

この他、出願公開制度、審査請求制度、変更出願制度など日本の手続などと類似する点が多いが、出願人の申請により早期公開が可能であること、審査請求期間が5年であることなど細部で異なっており、さらに、優先審査制度や、外国語出願が認められていない点など相当異なる部分もある。ただし、特許権の権利存続期間は原則的に出願日から20年を超えないとされており日本と同一である。

さらに、2007年7月1日からは、日本と同様に異議申立制度が廃止され、登録特許に対しては無効審判を通してのみ権利の有効性について争うことができるようになった。

2. 考案

実用新案法第2条第1項は“考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作である”と規定しており、発明より高度でないものをいい、さらに、物品に具体化された形態性を有する技術的思想、すなわち“物品の形状、構造又は組合に関する考案”のみ保護対象とし(実用新案法第4条)、“方法に関する考案又は化学物質に関する考案”は除外されている。

2006年10月1日から施行された改正実用新案法によれば、実体審査を行うという点で日本の実用新案法とは相違している。あわせて、審査前登録制度の廃止に伴い技術評価制度も廃止され、特許と実用新案間の二重出願制度を廃止し日本と同様に変更出願制度を新設した。なお、審査請求期限は出願日から3年であり、実用新案権の存続期間は出願日から10年となる日までである。

3. デザイン(意匠)

デザイン保護法第2条第1号は“デザインとは物品(物品の部分及び書体(フォント)を含む)の形状、模様、色彩又はこれらを結合したもので、視覚を通じて美感を引き起こさせるもの”と定義し、さらに“工業上の利用可能性、新規性及び創作性を揃えなければならない”としている(デザイン保護法第5条)。一部物品については無審査登録制度及び複数デザイン出願制度を導入している点、権利存続期間は設定登録日から15年である点で日本との差異がある。その他、類似デザイン登録出願(関連意匠制度)、部分デザイン登録出願、組物デザイン登録出願、秘密デザイン登録出願など日本と同様の手続も多い。

4. 商標及びサービスマーク

商標法第2条第1項第1号は、商品を生産、加工、証明又は販売することを業として営む者が、自らの業務に関連した商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する“記号、文字、図形、立体的形状、色彩、ホログラム、動作、又はこれらを結合したものの、その他視覚的に認識できるもの”を商標と定義し、韓国内での使用を前提条件とせずに登録のみにより独占的排他権を許与することをもって権利保護を図っている。商標権の存続期間は登録日から10年でその後は10年ずつの更新登録をすることで権利維持できる。ただし、未登録段階でも保護する価値がある周知著名商標などは、登録前段階でも商標法上の一定の地位を享有することができる。さらに、未登録商標であっても、他人の商標登録前に不正競争の目的でなく使用していた場合、その商標を使用した結果、出願時に国内需要者間にその商標が特定人の商品を表示するものであると認識されれば、先使用权も認定される。

また、商標の他にサービス業を営む者が自己のサービス業を他人のサービス業と区別できるようにするために使われる標章を「サービスマーク」として(商標法第2条第1項第2号)、同種業者又は同種業者及びこれと密接な関係がある業者が設立した法人がその監督の下にある団体員の営業に関する商品又はサービス業に使用するようになるための標章を「団体標章」として(同法第2条第3号)、地理的表示(商品の特定品質、名声又はその他の特性が、本質的に特定地域から発祥する場合にその地域で生産、製造または加工された商品であることを示す表示)を使用できる商品の生産などを業とする者だけで構成された法人又はその所属団体員の使用のための標章を「地理的表示団体標章」として認定しており(同法第2条第3号の4)、また、非営利業務を営む者がその業務を表象するために使用する標章を「業務標章」として定義し保護している(同法第2条第4号)。ただし、日本の防護標章登録に該当する制度は有していない。

5. 不正競争防止及び営業秘密

不正競争防止と共に営業秘密の保護のために 1986. 12. 31. 法律第 3897 号として不正競争防止法が制定された。不正競争防止法は、この法律によって排他的支配権を設定できるのではなく“不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止して健全な取引秩序を維持する”ことを目的としている(同法第 1 条)。

同法第 2 条第 1 号は、未登録商標や商号などでも、それに対して同項所定の不正競争行為に該当し得ることを認め民刑事上の保護を図っている。

同法第 2 条第 2 号には営業秘密を“公然と知られておらず独立した経済的価値を持つものであって、相当な努力によって秘密に維持された生産方法、販売方法その他営業活動に有用な技術上又は営業上の情報”と定義している。

現行法ではドメインネームの不当先取やデッドコピーが不正競争行為として規制され、営業秘密についても対象拡大と罰則強化が図られている。また、2007 年 12 月 21 日の改正により、不正な利益を得たり、企業に損害を被らせる目的でその企業に有用な営業秘密を外国で使用したり、外国で使用されることを知りながら取得・使用又は第三者に漏洩した者は 10 年以下の懲役又はその財産上の利得額の 2 倍以上 10 倍以下に相当する罰金に処すものとして既存の罰則規定を強化した(同法第 18 条第 1 項)。一方、2008 年 12 月 26 日の改正では、使用者である法人又は個人がその違反行為を防止するために該当業務に関して相当な注意と監督を怠っていない場合には、両罰規定を適用しないことで、両罰規定の適用を制限する規定を追加した。

なお、2007 年 4 月 28 日に施行された産業技術の流出防止及び保護に関する法律が、国家核心技術の海外流出防止などをより強化して規制しており、不正競争防止法とは違った側面での活用も考えられる。

6. 産業技術及び国家核心技術

2007 年 4 月 28 日から施行されている産業技術の流出防止及び保護に関する法律(最終改正 ; 2011 年 7 月 25 日、施行日 ; 2012 年 1 月 26 日)は「製品または用役の開発・生産・普及及び使用に必要な諸般方法または技術上の情報のうち関係中央行政機関の長が所管分野の産業競争力向上などのために法律又は該当法律で委任する命令(大統領令、総理令、部令に限定する)により、指定・告示・公告・認証する技術を「産業技術」として保護する。また、産業技術のうち「国内外の市場で占める技術的・経済的価値が高いか、または関連産業の成長潜在力が高いため海外に流出した場合に国家の安全保障及び国民経済の発展に重大な悪影響を及ぼす憂慮があるもの」を「国家核心技術」として指定し、その輸出に知識経済部長官の承認を得るようにするなど特別な管理ができるようにする根拠規定を置いている。

7. 文学、学術及び芸術作品

著作権法第2条第1号は「著作物」を「人間の思想又は感情を表現する創作物」と定義しており、著作物となるためには創作性がなければならないが、ここでいう創作性は特許法やデザイン保護法での新規性とは異なり、当該著作物の起源が著作者にあって他人のものを盗用したものでなければ事足りる。

ただし、著作権は創作と同時に権利が発生するという点、著作者の財産的利益以外にも著作者の人格的利益もその保護対象とみなすという点で特許権とは差がある。また、著作権は原則的に著作者の死亡後50年間存続し、保護期間が特許に比べ長期にわたるが、外国著作物に対する実際の保護については条約加盟時期や経過措置などにより内外国格差が事実上存在する。なお、1986年の全面改正後、9回の改正を経て2009年4月22日付公布され2009年7月23日付で施行された著作権法改正により著作権法とコンピュータプログラム保護法が統合され著作権法に一元化された。

8. デジタルコンテンツ

オンラインデジタルコンテンツ産業発展法(法律第6603号)によりデジタルコンテンツについても保護を受けられる。デジタルコンテンツとは電子的形態で製作または処理された符号・文字・音声・音響・イメージ・映像で表現された資料または情報であると定義され、相当な努力により製作され表示されたデジタルコンテンツを正当な権限無しに複製または伝送することにより製作者の営業に関する利益を侵害した者は1年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処せられ、さらに侵害行為者の雇用主にも両罰規定が適用される。ただし、その製作日から5年を経過したときはこの保護は受けられず、また、製作者が著作権法の保護を受けられる場合にはこの法は適用されない。

9. コンピュータプログラム

コンピュータプログラムは、著作権法の特別法的性格を有するコンピュータプログラム保護法(1986.12.31.法律第3920号)により保護されてきたが、2009年7月23日付で改正施行された著作権法により保護される。改正著作権法の保護の対象はコンピュータプログラムそのものであり、プログラムの言語、規約及び解決法には適用されない。ここでプログラムとは特定の結果を得るためにコンピュータなど情報処理能力を持った装置内で直接又は間接に用いられる一連の指示、命令で表現されたものをいう。

情報通信網を通じた不正複製物流通の迅速な遮断のために著作権保護委員会はオンラインサービス提供者に対して是正勧告をすることができ、著作権法などその他の知

的財産権法との平衡のためにプログラム著作権侵害行為に対する罰則も強化されている。

10. 半導体集積回路の配置設計

半導体集積回路の配置設計は、半導体チップ集積回路の配置設計に関する法律(1993.9.1.施行)により保護される。当該法律の保護対象は半導体集積回路を製造するために各種回路素子及びそれらを連結する導線を平面的または立体的に配置した設計である。1999年1月から特許庁が担当行政機関となっており、所定の申請書及び回路図面などを特許庁半導体集積回路配置設計登録室に提出し登録を受ける。配置設計権は設定登録より10年であり、外国人の配置設計権は1993年9月2日以降創作されたものが保護される。

[特許庁委託]
模倣対策マニュアル 韓国編

[著者]
金・張法律事務所
金容甲（模倣対策部分）
崔熙俊、李瓊宣（権利取得部分）
金尚源（構成・編集）

[発行]
日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階
TEL:03-3582-5198
FAX:03-3585-7289

2012年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2011年12月に入手した情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。